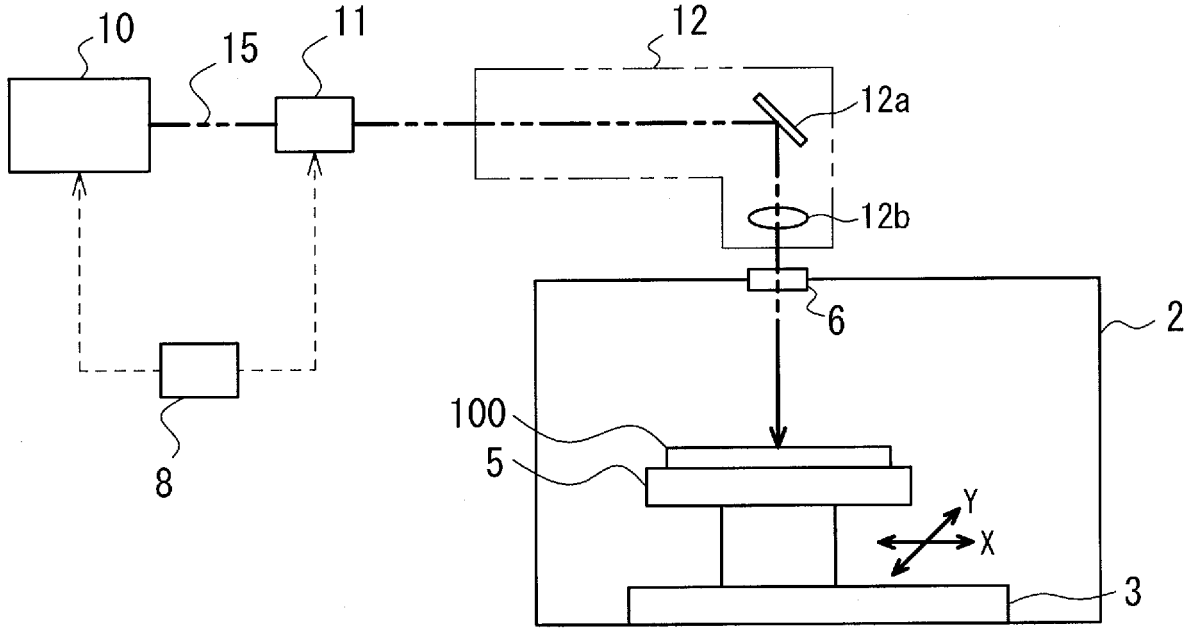
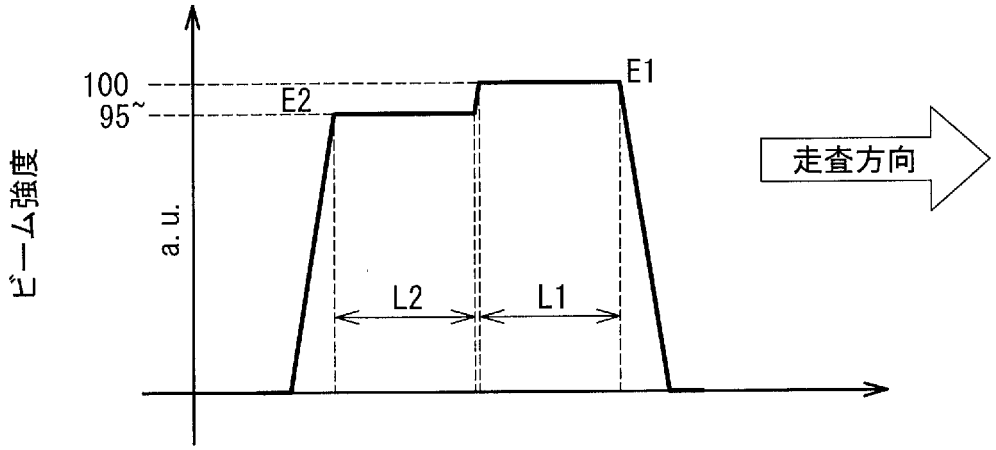
[図1]



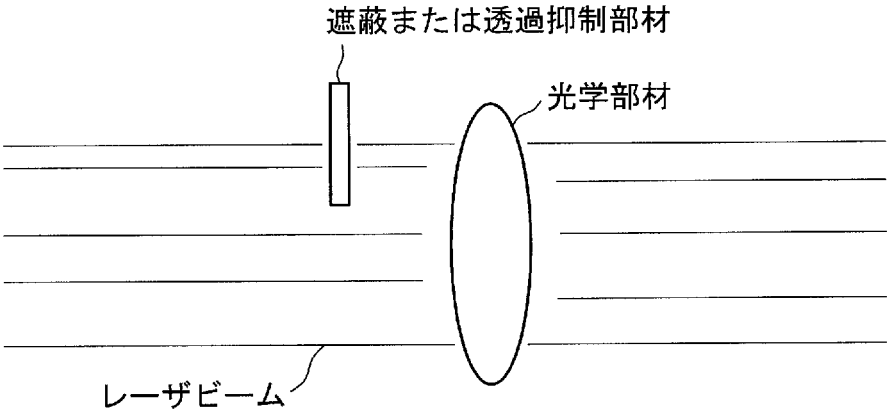
1

[図2]

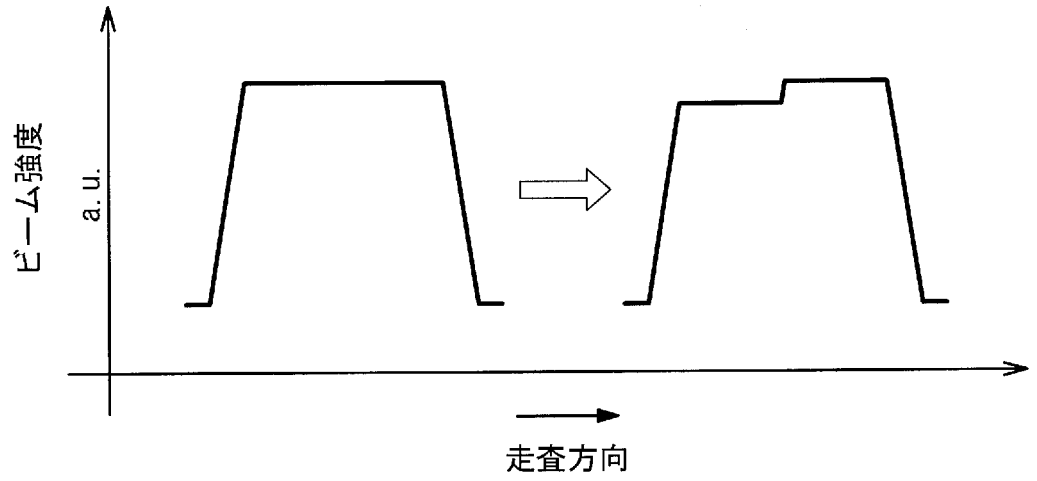


(a)

[図3]

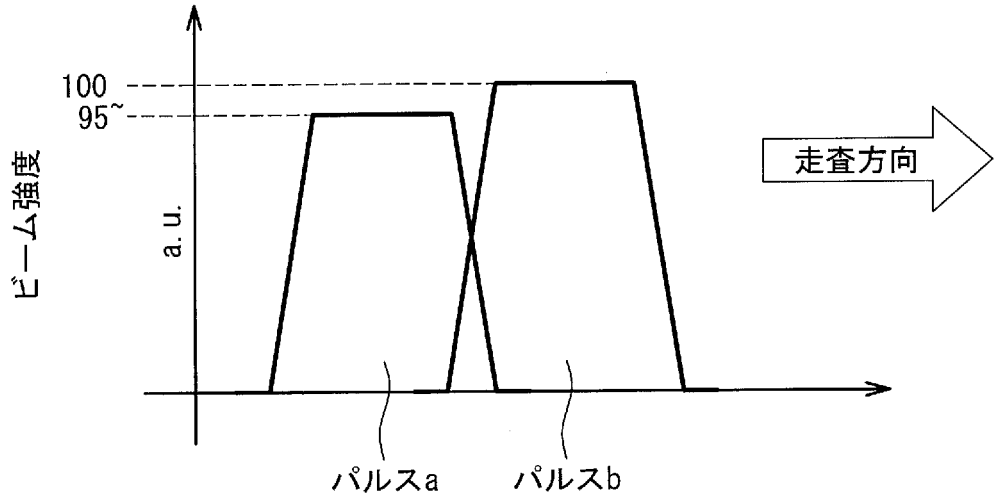


（ａ）

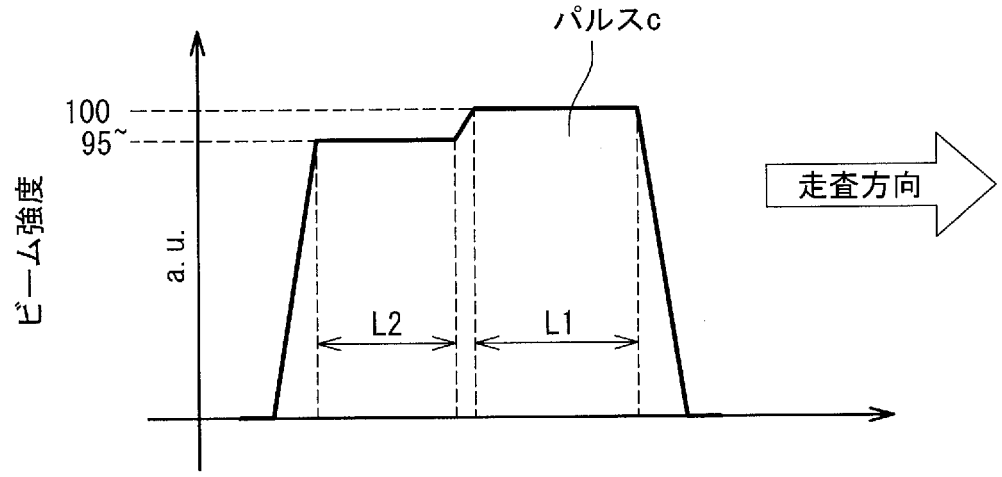


（ｂ）

[図4]

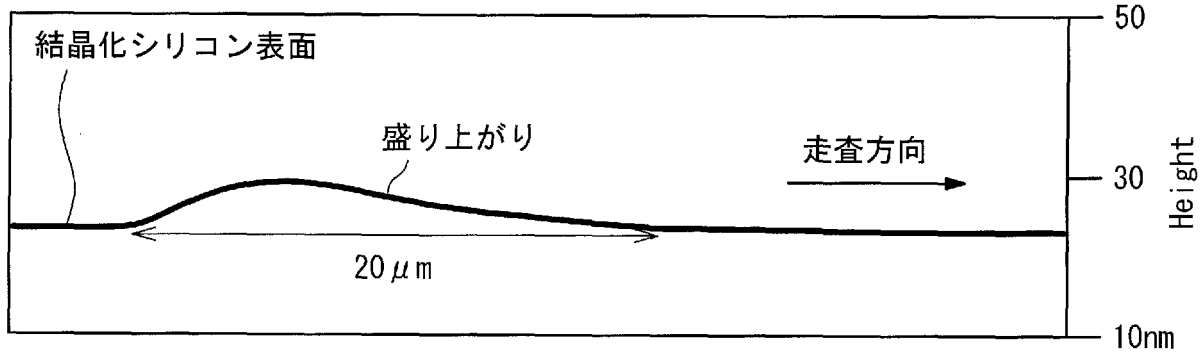


（ａ）

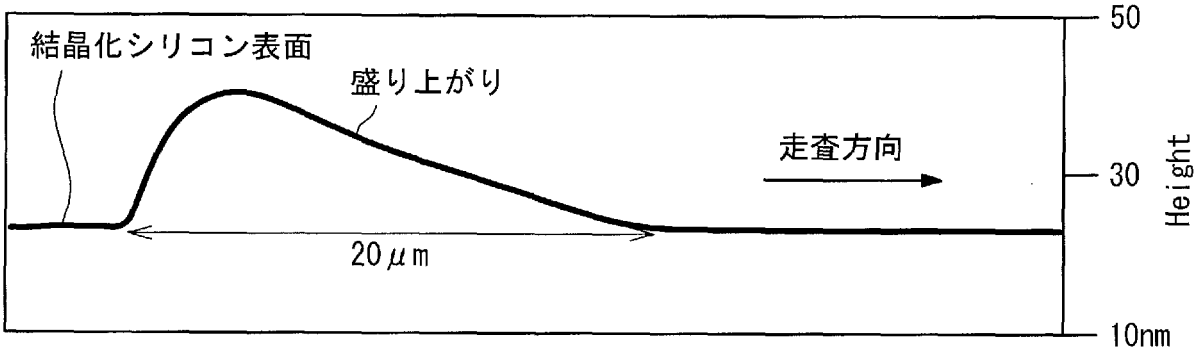


（ｂ）

[図5]

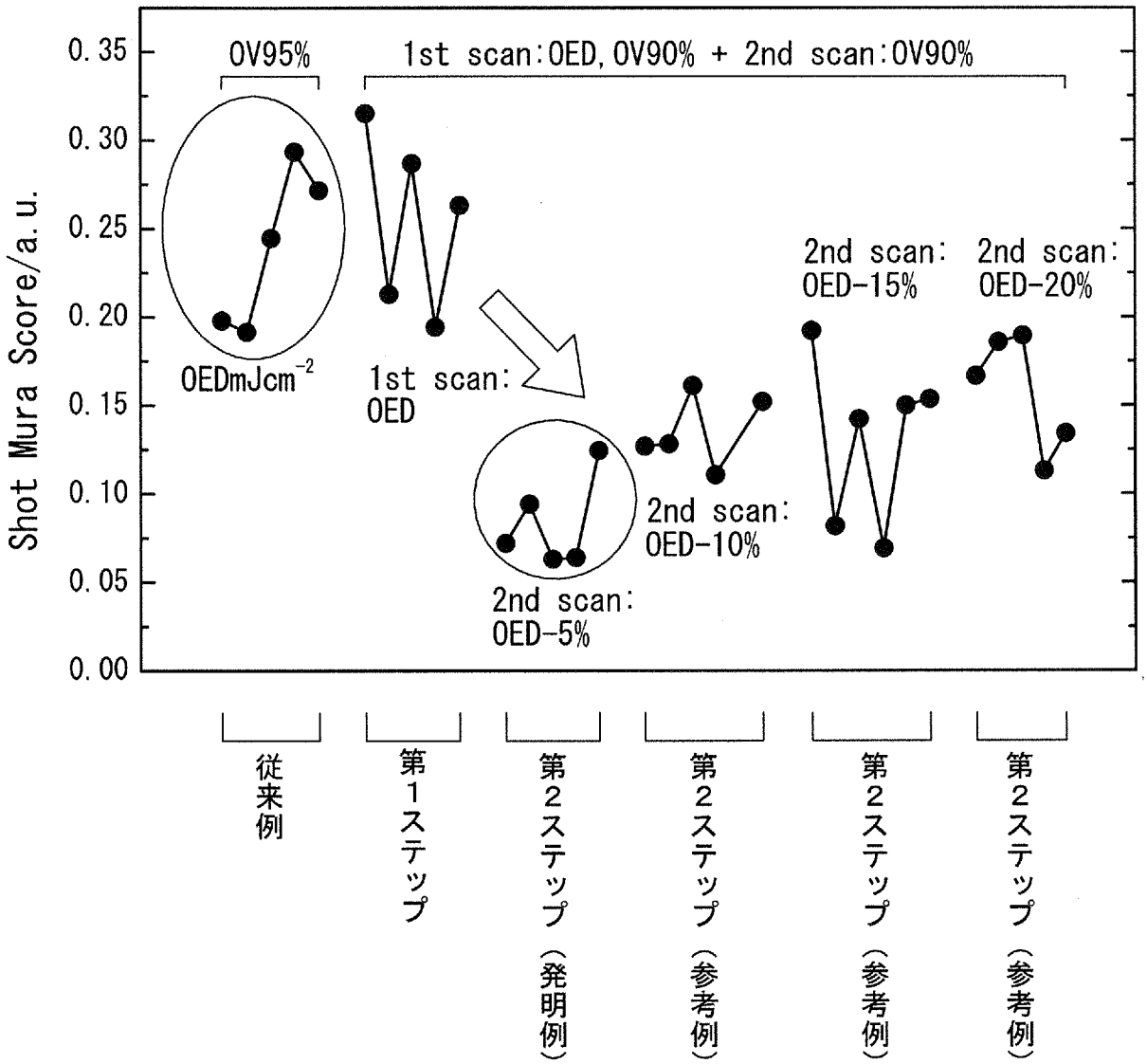

結晶化シリコン表面
盛り上がり
走査方向
20μm
50
30
10nm
Height

(a)


結晶化シリコン表面
盛り上がり
走査方向
20μm
50
30
10nm
Height

(b)

[図6]


Shot Mura Score/a.u.
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
OV95%
1st scan:OED, OV90% + 2nd scan:OV90%
OEDmJcm^{-2}
1st scan: OED
2nd scan: OED-5%
2nd scan: OED-10%
2nd scan: OED-15%
2nd scan: OED-20%
従来例
第1ステップ
第2ステップ（発明例）
第2ステップ（参考例）
第2ステップ（参考例）
第2ステップ（参考例）